



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ.

Позитивный жидкий фоторезист RD-2700.

RD-2700- позитивный фоторезист для полупроводникового производства. Благодаря превосходной термостойкости, фоторезист RD-2700 совместим с самыми разными технологическими процессами.

Характеристика RD-2700:

- i-, g-line;
- вязкость - 16 мПа·с;
- хорошая термостойкость;
- толщина слоя 1,0 ~ 3,5;

Применение.

- * производство сапфировых подложек с рисунком (PSS);
- * производство светодиодных чипов и т. д.

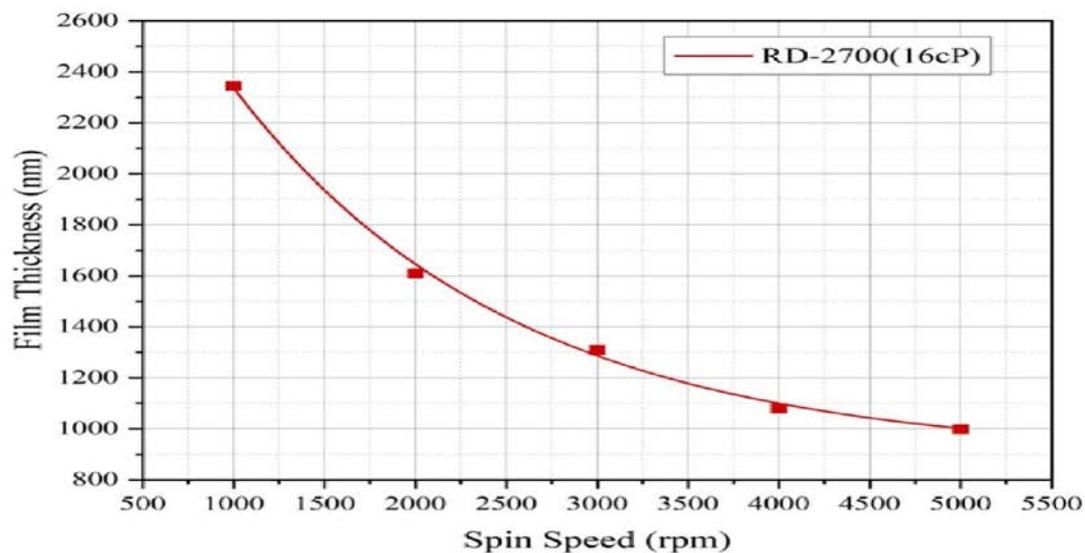
Технические характеристики:

Параметр	Спецификация
Вязкость	16,0±1,0 мПа·с
Толщина пленки при 1000 об/мин, мкм	1,0 ~ 3,5
Содержание частиц (>0,3 мкм)	Макс. 50 шт/мл
Разрешение	0,8 мкм
Содержание воды, %	Макс. 0,5% по весу
Следы металлов Примеси	Макс. 50 ppb

Параметры процесса

Нанесение на центрифуге, толщина	1,30 мкм при 3000 об/мин 2,00 мкм при 1380 об/мин
Термообработка	90°C, 60 с, горячая плита
Экспонирование	75~200 мДж/см ² @g-line экспозиция 60~160 мДж/см ² @i-line экспозиция
Сушка	115°C, 60 с, горячая плита
Проявление	2,38% ТМАГ, 60 с при 23°C, ванна
Термообработка	105~120°C, 120 с (горячая плита); 110~125°C, 30 мин. (сушильный шкаф)

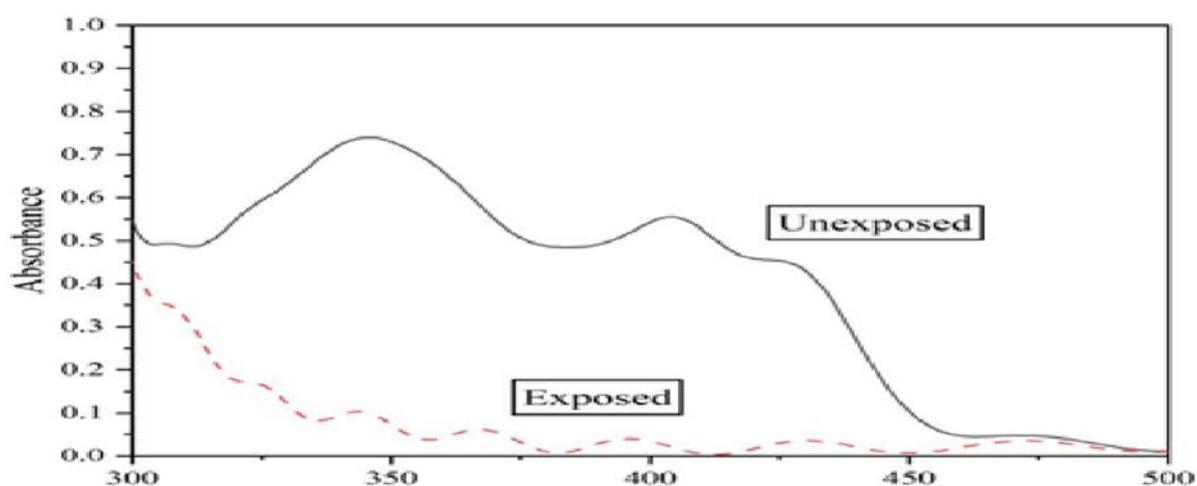
Кривая нанесения фоторезиста центрифугированием.



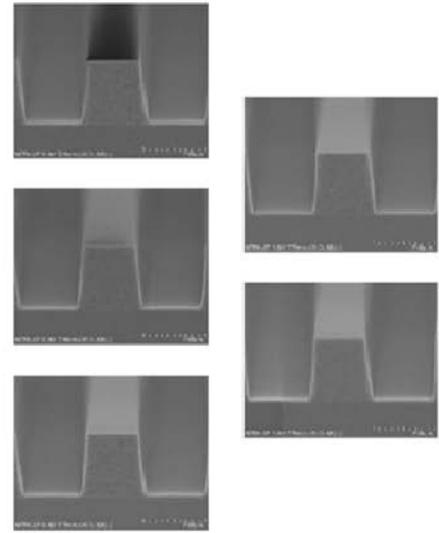
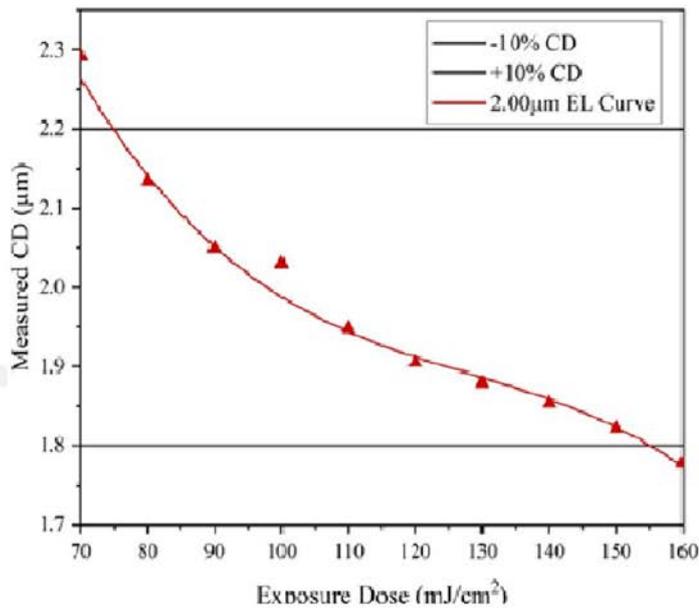
ОПТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ.

Длина волны (нм)	Значение Коши n	Значение Коши k
380	1.7079	0.011877
436	1.67031	0.005342
632	1.62341	0.001202

Кривая зависимости экспозиции от длины волны



Кривая зависимости шириты экспозиции от дозы облучения



Теплостойкость

ТемператураНЗ (°C)	Без выпечки	120	125	130	135	140
1 мм 1:1 Л/С						
10 мкм Линия ИСО						

Хранение

Хранить RD-2700 следует в вертикальном положении в плотно закрытых емкостях, в прохладном, сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре 4-21°C (40-70°F).

Хранить вдали от света, кислот, тепла и источников возгорания.

Меры предосторожности по охране окружающей среды.

Не допускать попадания материала в канализацию или водоемы.

Уведомлять компетентные органы, если утечка попала в водосток, канализацию или загрязнила почву или растительность.